

فرمولاسیون ژل رفع آلوودگی L-Gel و بررسی واکنش جزء فعال آن (اوکسون) با ترکیبات شبه خردل

* مهدی فرجی پور، حسین فخرائیان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، گروه شیمی

(دریافت: ۸۹/۰۸/۱۶، پذیرش: ۸۹/۱۲/۱۴)

چکیده

L-Gel به عنوان یک واکنشگر رفع آلوودگی مؤثر برای عوامل شیمیایی (CW) و عوامل بیولوژیکی (BW) می‌باشد. فرمولاسیون آن شامل محلول آبی اوکسون به عنوان عامل اکسنده و کابوسیل به عنوان عامل ژل کننده است. L-Gel نسبتاً ارزان، غیررسمی، غیرمخرب برای محیط‌زیست، نسبتاً غیرخورنده، دارای سیستم پاشش ساده و به دلیل ماهیت تیکسوتروبیک دارای بیشترین زمان تماس است. برای تهیه فرمولاسیون بهینه L-Gel اجزاء سازنده آن به نسبت‌های مختلف با یکدیگر مخلوط شد و با اندازه‌گیری‌های خواص متفاوت ژل از جمله گرانزوی و چگالی، فرمولاسیون بهینه نهایی به دست آمد. این فرمولاسیون شامل محلول آبی ۱ مولار اوکسون به همراه کابوسیل به میزان ۱۵ درصد وزنی بود. مدت زمان هم‌زدن لازم برای تشکیل ژل، ۳۰ دقیقه به دست آمد. بعد از این مدت، گرانزوی ژل با گذشت زمان در اثر ساکن ماندن افزایش یافت. استفاده از این فرمولاسیون بعد از هم‌زدن و کاهش گرانزوی امکان پذیر می‌شود. عامل اصلی رفع آلوودگی L-Gel اوکسون است که جزء اصلی واکنش دهنده آن، پتانسیم پروکسی مونوسولفات (KHSO₅) می‌باشد. برای بررسی میزان رفع آلوودگی ترکیبات شبه خردل از روش GC و ¹H NMR استفاده شد. متیل فنیل سولفید (MPS) در واکنش سریع با اوکسون در مدت ۳ دقیقه به متیل فنیل سولفوکسید و متیل فنیل سولفون تبدیل شد ولی کلرواتیل فنیل سولفید (CEPS) واکنش بسیار کندتری با اوکسون داشت و بعد از ۲ ساعت به کلرواتیل فنیل سولفون تبدیل گردید.

کلیدواژه‌ها: L-Gel، کابوسیل؛ رفع آلوودگی، متیل فنیل سولفید، کلرواتیل فنیل سولفید، شبه عوامل خردل، عوامل جنگ شیمیایی

Formulation of L-Gel Decontaminating Agent and Investigation of its Active Ingredient (Oxone) Reaction with Mustard Simulants

M. Farahipour, H. Fakhraian*

Department of Chemistry, Imam Hossein University

Abstract

“L-Gel” is a decontamination reagent that is effective both against chemical warfare (CW) and biological warfare (BW) agents. This reagent consists of an aqueous solution, Oxone, together with a fumed silica gelling agent Cab-O-Sil EH-5. L-Gel is relatively inexpensive, non-toxic, environmentally friendly, relatively non-corrosive, requires simple delivery system and maximizes contact time due to its thixotropic nature. Experiments to achieve optimized formulation for L-Gel were conducted. Different mixtures of Oxone and Cab-O-Sil were prepared and their viscosity and density were measured. The final optimized formulation of gel included 1.0M aqueous solution of Oxone gelled with 15% W/W of Cab-O-Sil EH-5. A stirring time of 30 minutes was achieved after which viscosity of gel increased over time. To be suitable for decontamination of chemical warfare agents, this formulation should be less viscous and stirred well before use. The effective agent for decontamination is Oxone, in which active ingredient is potassium peroxyomonosulfate “KHSO₅”. The reaction mixture was analyzed by GC and ¹H NMR for HD simulants. In 3 minutes, Methyl phenyl sulfide (MPS) was converted to methyl phenyl sulfoxide and methyl phenyl sulfone as decontamination products with a higher reaction rate while chloro ethyl phenyl sulfide (CEPS) was decontaminated with a lower rate leading to chloro ethyl phenyl sulfone in 2 hours.

Keywords: L-Gel, Oxone, Cab-O-Sil EH-5, Decontamination, Methyl Phenyl Sulfide (MPS), Chloro Ethyl Phenyl Sulfide (CEPS), Mustard Simulants, Chemical Warfare Agents

* Corresponding author E-mail: Fakhraian@yahoo.com

Passive Defence Sci. & Technol. 2011, 3, 27-36

سطح عمودی و افقی بالاسری است. فناوری‌های فوم و ژل طوری طراحی می‌شوند که میزان رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی را در اثر رهاکردن فرمولاسیون‌های رفع آلودگی در ماتریسی که می‌تواند در سطوح افقی یا عمودی کاربرد داشته باشد، افزایش دهد. این ویژگی، امکان کاربرد آن‌ها در دیوارها با زمان تماس کافی فراهم و تضمین می‌کند که عامل شیمیایی و بیولوژیکی با این عوامل بهطور مؤثر رفتار کند. سه فناوری در این طبقه ارزیابی می‌شوند: ساندیافوم/دیکون گرین^۱، L-Gel و CASCAD. فناوری‌های گازی و بخار شامل: گاز دی‌اکسید کلر، اتیلن اکسید، هیدروژن پراکسید فاز بخار، پارافرمالدید، اوزون و متیل برミد می‌باشد^[۲]. از جدیدترین و مؤثرترین این روش‌ها، می‌توان به رفع آلودگی با L-Gel اشاره نمود^[۳]. در رفع آلودگی از مناطق آلوده بهویژه مناطق جنگی، سرعت رفع آلودگی از تجهیزات و نیروها از یک سو و عدم تخریب و آسیب به تجهیزات و ادوات جنگی از سوی دیگر بسیار مهم می‌باشد، L-Gel به دلیل ماهیت غیرسمی و غیرخودنگی و سرعت بالای رفع آلودگی، یک عامل رفع آلودگی بسیار مناسب برای کاربردهای نظامی و غیرنظامی می‌باشد ضمن اینکه هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی‌سازد^[۴].

L-Gel دارای سه مشخصه مهم است: ۱. باعث اکسیداسیون عوامل شیمیایی جنگی می‌شود، ۲. باعث کشتن هاگ‌های باکتریایی مورد استفاده در عوامل بیولوژیکی جنگی می‌شود، ۳. به تمام سطوح از جمله سطوح عمودی و سقفها می‌چسبید^[۴].

L-Gel متشکل از دو جزء اصلی یعنی عامل اکسنده و عامل ژل کننده می‌باشد^[۴]. اوکسون با فرمول مولکولی $2\text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$ عامل اکسنده در L-Gel است. اوکسون یک ترکیب غیرکله است که برای کلریدایی و ضدغفونی کردن استفاده می‌شود. به طور مشابه در فرمولاسیون ساندیافوم، این ماده اکسیدان‌ها را با سورفاکtant برای تخریب عوامل بیولوژیکی ترکیب می‌کند. مشخص شده است که اوکسون به طور موثر با عوامل شیمیایی واکنش می‌دهد. جزء فعال در اوکسون، پتانسیم پروکسی مونوسولفات_(KHSO₅) است. آنیون پروکسی مونوسولفات یک اکسنده ملایم با قدرت کافی برای اکسیدکردن آنیون هالید به هالوژن (خنثی) یا به آنیون هیپوهالیت، کاتیون آهن(II) به آهن(III) و کاتیون منگنز

۱. مقدمه

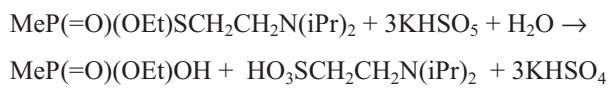
به منظور حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، رفع آلودگی از اهمیت اجتناب ناپذیری برخوردار می‌باشد. هدف از رفع آلودگی در واقع تبدیل سریع و مؤثر عامل به ترکیبات بی‌ضرر و یا زدودن آن از پرسنل و تجهیزات و محیط است^[۱]. داشتن توان رفع آلودگی بالا برای نیروهای خودی، میزان تأثیرپذیری در مقابله حمله‌های شیمیایی را کاهش داده و می‌تواند یک عامل بازدارنده در مقابله حمله‌های شیمیایی دشمن باشد. رفع آلودگی در صحنه‌های نبرد به معنای حذف سریع عوامل شیمیایی از خودروهای نظامی، دستگاه‌ها، پرسنل و امکانات توسط روش‌های فیزیکی و شیمیایی است^[۲] ولی باید با استفاده از هشدار و پیش‌بینی‌های لازم، نیاز به رفع آلودگی را به حداقل ممکن کاهش داد. به عنوان مثال تجهیزات باید پوشانده شود و یا مقاوم‌سازی تجهیزات آسیب‌پذیر در مقابله آلودگی، با یک طراحی مناسب پوششی صورت گیرد^[۲]. عوامل عصبی و عواملی که باعث آسیب‌های پوستی و ضایعات تنفسی می‌شوند به راحتی حل شده و می‌توانند در مواد مختلفی مانند رنگ، پلاستیک و لاستیک نفوذ نمایند و در نتیجه رفع آلودگی را مشکل‌تر نمایند^[۱].

چنان‌که عامل شیمیایی در عمق کافی نفوذ کند، حتی اگر ظاهراً سطوح مواد رفع آلودگی شده باشند تا مدت‌ها می‌تواند با متصاعد نمودن گازهای سمی موجب آلودگی شود^[۳]. با افزایش برخی ترکیبات به عامل می‌توان گرانروی و در نتیجه، چسبندگی و ماندگاری آن را در محیط افزایش داد؛ در این-

صورت رفع آلودگی چنین عواملی مشکل‌تر خواهد بود^[۳]. روش‌های رفع آلودگی بسیاری از جمله: محلول‌ها، فوم‌ها، ژل‌ها و فناوری‌های گازی و بخار برای رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی جنگی صورت پذیرفته است که هریک دارای مزایا و معایبی می‌باشند^[۴-۱۳]. فناوری مایع، شامل کاربرد مستقیم محلول‌های مایع رفع آلودگی بر روی سطوح آلوده شده با عامل شیمیایی یا بیولوژیکی می‌باشد. هفت فناوری در این طبقه قرار دارند که عبارتند از: هیپوکلریت (مانند بلیچ)، هیدروژن پراکسید آبی، دی‌اکسید کلر آبی، HPO₂, DS2, TechXtract و نانو امولسیون. با استفاده از این فناوری‌ها، محلول‌ها قابل استفاده برای رفع آلودگی سطوح یا مواد شده و محلول‌ها نیز در اثر خشکشدن یا خلاء مرطوب پس از کاربرد حذف می‌شوند. از جمله معایب این روش‌ها، عدم امکان استفاده مناسب و مؤثر در

می شود [۱۵].

در آزمایش‌های انجام شده توسط رابر و مک‌کواری^۱ مشخص شد که اوکسون باعث اکسید شدن VX به اتیل متیل فسفونیک اسید و دی‌ایزو پروپیل تأثیری نمی‌شود [۱۶]:



عامل ژل کننده در L-Gel، کابوسیل فیوم سیلیکا^۲، یک کلوئید سیلیکا بی‌شکل سنتزی (سیلیکون دی‌اکسید) تهیه شده توسط شرکت کابوت^۳ می‌باشد. خلوص بالا، ساختار متراکم، سایز کمتر از میکرون ذرات، چگالی پایین، سطح تماس بالا ($380\text{ m}^2/\text{g}$) و سطح آب‌دوست از ویژگی‌های برتر نوع EH-5 نسبت به سایر انواع کابوسیل می‌باشد. اندازه متوسط ذرات EH-5 که فقط در حدود $200\text{ }\mu\text{m}$ میکرومتر است، دارای سطح خیلی بالایی از فیوم سیلیکا است که باعث تغليظ و ایجاد خاصیت تیکسوتروپی، افزایش و پایداری گرانروی در سیستم‌های مایع و ایجاد استحکام کافی سیلیکون و لاستیک‌های آلی می‌شود [۱۷].

L-Gel به صورت یک ماده نیمه جامد ژلاتینی با گرانروی بالا بسته‌بندی و نگهداری می‌شود. این ماده نیمه جامد در اثر همزدن یا تکان دادن به مایع ژلاتینی تبدیل شده و به راحتی با استفاده از تجهیزات پاشش استفاده می‌شود. قابل ذکر است که به دلیل ماهیت اسیدی L-Gel، نازل‌ها باید از جنس فولاد ضدزنگ باشند [۱۴].

خردل حل شده در آب به سرعت هیدرولیز می‌شود، اما انحلال آن در آب کند است؛ بنابراین سمزدایی در محلول آبی از طریق اکسیداسیون صورت می‌گیرد و هیدرولیز روش مناسبی برای رفع آلوودگی نیست [۳]. محصولات عمده رفع آلوودگی خردل (HD) از طریق اکسیداسیون، سولفوكسید (HDO) و سولفون (HDO₂) است. سولفوكسید دارای سمیت بیشتری نسبت به سولفون است، بنابراین سعی می‌شود شرایط واکنش به‌گونه‌ای باشد که محصول سولفون ایجاد شود [۱۰-۱۳].

با توجه به این ویژگی‌ها، در این پژوهش فرمولاسیون ژل رفع آلوودگی کننده L-Gel و رفع آلوودگی شبه‌عوامل خردل توسط جزء موثر آن (اوکسون) مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. بخش تجربی

۲-۱. مواد و دستگاه‌ها

اوکسون از شرکت مرک^۴ و کابوسیل EH-5 از شرکت کابوت تهیه شدند. برای تعیین گرانروی به روش دستگاهی از دستگاه ویسکوومتر DV-II + Pro DV-II + Pro کفیل^۵ استفاده شد. طیف‌های H NMR توسط دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته مدل CDCl₃ با قدرت میدان ۲۵۰ مگاهرتز در حضور حلال‌های D₂O به دست آمد. کروماتوگرام‌های گازی (GC)، توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) مدل واریان^۶ با ستون پر شده OV-101 CWHP 80/100، 2m×1.8" (10% OV-101) و جریان گاز حامل He با سرعت ۱۰ ml/min به دست آمد. زمان‌های بازداری بر اساس برنامه دمایی $100\text{--}250^\circ\text{C}$ (۵ °C/min) و دمای دتکتور و دمای محل تزریق $210\text{--}250^\circ\text{C}$ گزارش شده است. آنالیز GC-MS به روش یونیزاسیون الکترونی با دستگاه واریان^۷ مدل و ستون کاپیلاری (DB 5 MS, 0.1 micron, 30m×0.25mm) و سیستم های مایع و لاستیکی ایجاد استحکام کافی سیلیکون و لاستیک‌های آلی می‌شود [۱۷].

۲-۲. تهیه فرمولاسیون بهینه L-Gel

فرمولاسیون بهینه L-Gel شامل محلول آبی ۱ مولار اوکسون به همراه ۱۵٪ وزنی محلول کابوسیل EH-5 بود. برای تهیه ژل پایدار و مناسب، ابتدا ۱۵ میلی‌لیتر محلول یک مولار اوکسون ۲/۲۹ گرم اوکسون در ۱۵ میلی‌لیتر آب (مقدار) تهیه و سپس ۲/۶ گرم کابوسیل به آرامی و طی چندین مرتبه به محلول فوق اضافه شد و توسط همزن دستی به مدت ۵-۱۰ دقیقه به سرعت همزدن شد. سرعت همزدن در یکنواختی ژل تهیه شده بسیار موثر است، ضمن این‌که باید با همزدن زیاد از کلوئید شدن ذرات کابوسیل جلوگیری کرد. سپس ژل اولیه با استفاده از همزن مغناطیسی (یا همزن مکانیکی در حجم زیاد) با سرعت نسبتاً بالایی به مدت ۳۰ دقیقه همزده شد. اگر نیاز به استفاده سریع L-Gel باشد، بعد از ۳۰ دقیقه، ژل باید به مدت یک ساعت بدون همزدن در تماس با هوا باشد تا شبکه

4. Merck

5. DV-II + Pro Brookfield

6. Bruker ADVANCE DPX 250 MHz

7. Varian STAR 3400CX

8. SATURN 4D

1. Ellen Raber & Raymond McGuire

2. Cab-O-Sil EH-5 fumed silica

3. Cabot

بوده و گرانروی ژل افزایش می‌باید، بخشی از ژل غلیظ بر روی اسپندل جمع شده و باعث ایجاد خطأ در سنجش گرانروی می‌شود.

۲-۵. رفع آلودگی متیل فنیل سولفید (MPS)
۰/۰۰۰۱ مول (۰/۰۱۲ گرم) MPS به ۱ میلی لیتر محلول ۰/۵ مولار (۰/۰۷۶ گرم) اوکسون اضافه شد. نمونه ابتدا به رنگ زرد تبدیل شد که با همزدن، به تدریج رنگ زرد از بین رفت و بی رنگ شد. نمونه پس از ۳ دقیقه واکنش توسط دی‌کلرومتان استخراج و کروماتوگرام آن گرفته شد.

۲-۶. رفع آلودگی کلرواتیل فنیل سولفید (CEPS)
ابتدا ۰/۰۰۰۲ مول (۰/۰۳۴ گرم) CEPS به همراه ۱ میلی لیتر اتانول به عنوان حلال به ستون GC تزریق و کروماتوگرام آن گرفته شد. سپس ۰/۰۰۰۲ مول (۰/۰۳۴ گرم) CEPS به ۱ میلی لیتر محلول ۲ مولار (۰/۰۳ گرم) اوکسون اضافه و با همزدن معناطیسی به مدت ۳۰ دقیقه همزده شد. مخلوط حاصل ابتدا دو فازی شد؛ به طوری که CEPS به صورت ذرات ریز معلق در زیر فاز آبی تنهشین شد که در اثر واکنش با اوکسون به صورت ذرات ریز در بالای فاز آبی قرار گرفت و با گذشت زمان از فاز پایینی کاسته و به فاز بالایی افزوده می‌شد. بعد از طی زمان‌های معین بخشی از نمونه توسط دی‌کلرومتان استخراج و کروماتوگرام آن گرفته شد.

برای اثبات ساختار ترکیبی که در اثر اکسیداسیون CEPS با اوکسون به دست آمده ابتدا طیف ^1H NMR کلرواتیل فنیل سولفید در کلروفرم گرفته شد. سپس ۱ میلی لیتر محلول ۲ مولار (۰/۰۳ گرم) اوکسون به محلول ۰/۱۳ مولار (۰/۰۲۳ گرم) کلرواتیل فنیل سولفید اضافه و بعد از ۱۵ دقیقه واکنش، نمونه با استفاده از حلal₃ CDCl₃ استخراج و طیف ^1H NMR و GC-MS آن بررسی شد.

۳. نتایج و بحث

۳-۱. تهیه فرمولاسیون بهینه L-Gel

برای تهیه فرمولاسیون بهینه، تأثیر عوامل مختلفی مانند حضور هوا، نحوه همزدن، درصد کابوسیل و حضور اوکسون بر روی ژل، مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از آن در شکل‌های (۱) تا (۵) آمده است.

سه بعدی ژل کامل شده و گرانروی به مقدار بیشینه بر سرده ولی برای ذخیره‌سازی، باید بعد از ۳۰ دقیقه درب ظرف بسته شده و هنگام استفاده، ابتدا باید توسط همزن مکانیکی یا شیکر هم-زده -تا جایی که روان شود- و سپس به مدت چند ساعت بدون حرکت تا جایی که گرانروی مجددًا افزایش یافته و به شکل ژل ویسکوز قابل استفاده شود، نگهداشته می‌شود.

۲-۳. اندازه‌گیری گرانروی با روش سقوط آزاد جسم کروی

روش سقوط آزاد جسم کروی بر اساس قانون استوک، رابطه (۱) می‌باشد.

$$U_t = \frac{g D_p^2 (\rho_p - \rho)}{18 \mu} \quad (1)$$

U_t = سرعت حد، D_p = قطر جسم کروی، ρ_p = چگالی جسم کروی، ρ = چگالی سیال، μ = گرانروی سیال.

برای اندازه‌گیری گرانروی با این روش، ۷ میلی لیتر ژل داخل لوله آزمایش ریخته و در میانه لوله، دو علامت به فاصله ۷ سانتی‌متر گذاشته شد. گوی فلزی با وزن یک گرم و قطر ۶/۶ میلی‌متر که تمیز شده بود از بالای ستون درست روی سطح ژل در وسط ستون رها شد. وقتی گوی به علامت اول رسید با استفاده از کرنومتر، زمان حرکت گوی در فاصله بین دو علامت اندازه‌گیری و سپس با محاسبه سرعت و با استفاده از قانون استوک، گرانروی محاسبه گردید.

۲-۴. اندازه‌گیری گرانروی با استفاده از دستگاه ویسکومتر بروکفیلد

ویسکومتر DV-II + Pro دارای یک میله فلزی به نام اسپندل^۱ می‌باشد که این میله درون سیال با سرعت‌های متفاوت در حال چرخش است و در اثر چرخش آن، گرانروی اندازه‌گیری می‌شود. هرچه سرعت چرخش اسپندل درون سیال بیشتر باشد، دقت داده‌های خروجی دستگاه بیشتر است.

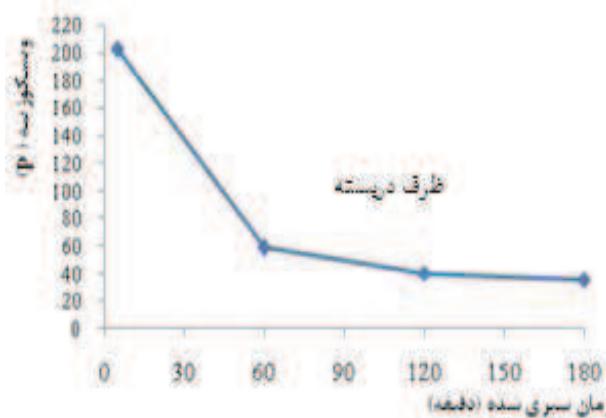
استفاده از این روش، تنها برای بررسی نحوه تغییرات گرانروی ژل بهینه‌هنگامی که شبکه آن در اثر همزدن در حال گستن می‌باشد مناسب است؛ زیرا وقتی شبکه ژل در حال تشکیل

1. Spindle

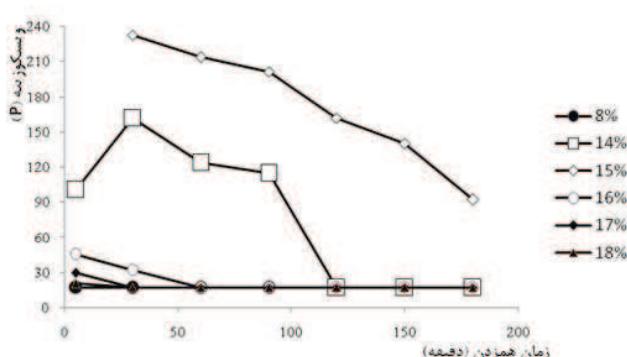
است بهدلیل خاصیت تیکسوتروپی، گرانروی در حال افزایش است. این افزایش تا زمانی که شبکه کامل شود ادامه خواهد داشت. پس از این که شبکه به تکامل خود برسد و گرانروی بیشینه شود، اگر ژل همzedه شود، شبکه دچار ضعف شده و مدت زمان بیشتری برای بازگشت شبکه به حالت قبلی لازم است، بنابراین گرانروی کاهش می‌یابد.

درصد کابوسل نیز در کیفیت ژل تاثیر بسیار دارد. وقتی درصد کابوسل کمتر از ۸٪ وزنی محلول باشد، ژلهای حاصل ناپایدار و دوفازی هستند و حتی بعد از همگن کردن نمونه، مجدداً دوفازی می‌شوند. وقتی درصد آن بیشتر از ۸٪ وزنی محلول باشد، ژلهای حاصل پایدار و تک فازی هستند بهطوری که حتی پس از گذشت زمان و با سانتریفیوژ کردن نمونه با دور بالا نیز همچنان همگن و تکفاز باقی می‌مانند. با افزایش میزان کابوسل، گرانروی افزایش می‌یابد و هنگامی که مقدار آن به ۱۵ درصد وزنی محلول می‌رسد، بیشینه مقدار گرانروی مشاهده می‌شود. با ادامه یافتن افزایش میزان کابوسل، روند تغییرات گرانروی بر عکس می‌شود و گرانروی کاهش می‌یابد (شکل (۳) و (۴)). در ابتدای همzedن ژل ویسکوز شده به منظور استفاده از آن، کاهش گرانروی با سرعت زیادی انجام می‌شود، ولی بعد از آن، این روند با سرعت کمتری انجام می‌شود. این موضوع بیانگر این است که در ابتدا شبکه ژل دچار یک فروپاشی و گسیستان ناگهانی می‌شود ولی در ادامه این روند کنتر می‌شود (شکل (۵)).

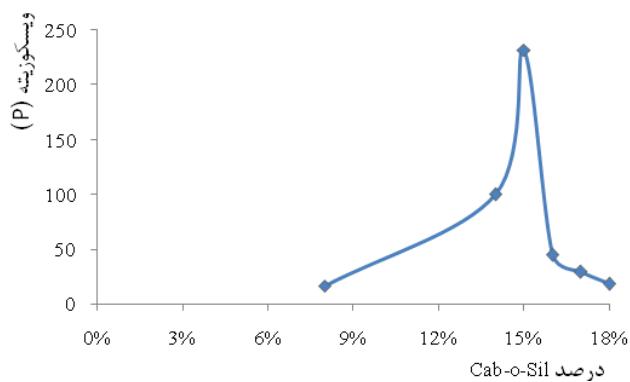
در اثر همzedن بهعلت خاصیت تیکسوتروپی ژل، گرانروی کاهش می‌یابد ولی وقتی نمونه در غیاب هوا باشد، گرانروی با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد، بهطوری که در زمان‌ها و شرایط همzedن یکسان، دارای گرانروی کمتری نسبت به حالتی که در حضور هوا است، می‌باشد (شکل (۱)). سرعت همzedن در تشکیل شبکه سه‌بعدی ژل مهم است (شکل (۲-الف)، ب و ج)). ابتدا نمونه به مدت ۱۰ دقیقه در شکل (۲-الف) توسط همزن دستی و در شکل (۲-ب) توسط همزن مغناطیسی همzedه شد و گرانروی اولیه آن‌ها اندازه‌گیری شد. چون قدرت و سرعت همzedن توسط همزن دستی کمتر از همزن مغناطیسی می‌باشد، شبکه هنوز کامل نشده و در حال کامل شدن می‌باشد، بنابراین گرانروی آن نسبت به شکل (۲-ب) که دارای مدت همzedن یکسان است، کمتر ولی در اثر ساکن ماندن و تکامل شبکه، گرانروی در حال افزایش است. مدت زمان همzedن نیز در تشکیل شبکه سه‌بعدی ژل مهم می‌باشد. با توجه به این که مدت زمان همzedن اولیه در شکل (۲-ج)، سه برابر شکل (۲-ب) می‌باشد، شبکه نسبت به (ب) کامل‌تر و دارای گرانروی بیشتری می‌باشد. کاهش گرانروی در شکل (۲-ج) بهدلیل همzedن و خاصیت تیکسوتروپی ژل می‌باشد، بهطوری که اگر نمونه به مدت چندین ساعت بدون همzedن باقی بماند، گرانروی آن مجدداً افزایش می‌یابد. زمان لازم برای کامل شدن شبکه ژل، ۳۰ دقیقه می‌باشد، بهطوری که در اثر همzedن بیش از این مدت، شبکه دچار اختلال شده و گرانروی کاهش می‌یابد (شکل (۲-ج)). در شکل (۲-ب) شبکه در حال کامل شدن است و از طرفی چون ژل بدون حرکت



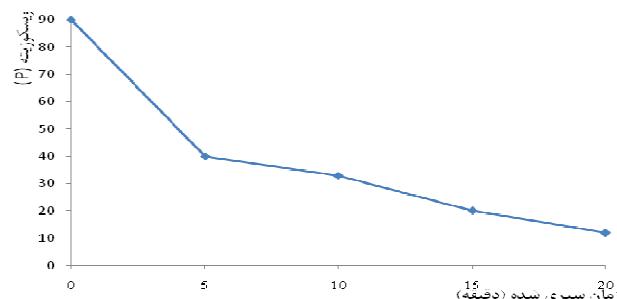
شکل ۱. تاثیر هوا بر روی گرانروی نمونه A (محلول ۱ مولار اوکسون شامل ۱۰٪ وزنی کابوسل)



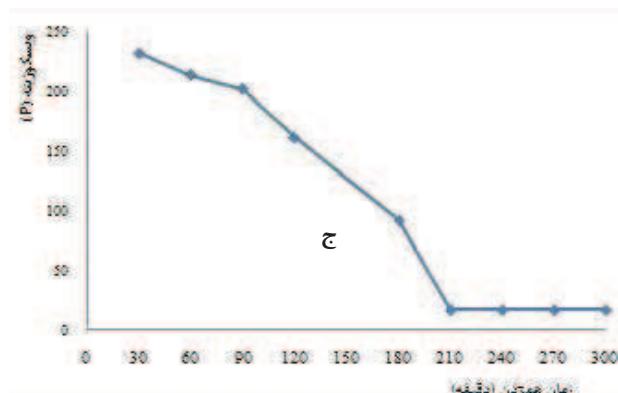
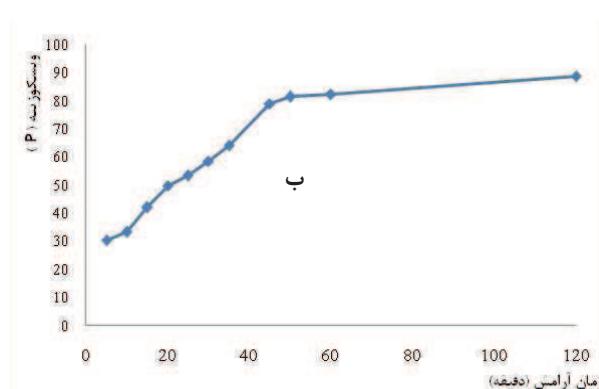
شکل ۳. تأثیر درصد کابوسل بر روی گرانروی نمونه‌های حاوی محلول ۱ مولار اوکسون و ۸٪، ۱۴٪، ۱۵٪، ۱۶٪، ۱۷٪ و ۱۸٪ کابوسل



شکل ۴. تأثیر درصد کابوسل بر روی گرانروی بیشینه نمونه‌های حاوی محلول ۱ مولار اوکسون و ۸٪، ۱۴٪، ۱۵٪، ۱۶٪، ۱۷٪ و ۱۸٪ کابوسل



شکل ۵. تغییرات گرانروی ژل نیمه‌جامد شده نمونه B (فرمولاسیون بهینه شامل محلول ۱ مولار اوکسون و ۱۵٪ وزنی کابوسل) در اثر همزدن



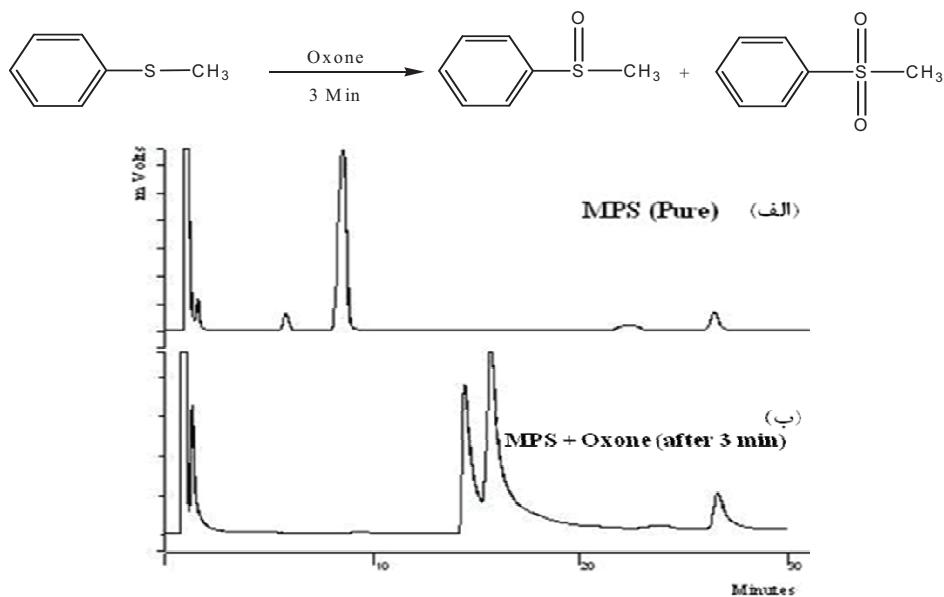
شکل ۲. تأثیر همزدن بر روی گرانروی نمونه B (فرمولاسیون بهینه شامل محلول ۱ مولار اوکسون و ۱۵٪ وزنی کابوسل) (الف) همزدن توسط همزدن دستی به مدت ۱۰ دقیقه و سپس سکون نمونه، (ب) همزدن توسط همزدن مغناطیسی به مدت ۱۰ دقیقه، سکون نمونه به مدت یک ساعت و مجدداً همزدن، (ج) همزدن توسط همزدن مغناطیسی به طور پیوسته

نتیجه‌گیری را نیز در مورد محصولات رفع آلودگی MPS توسط اوکسون داشت.

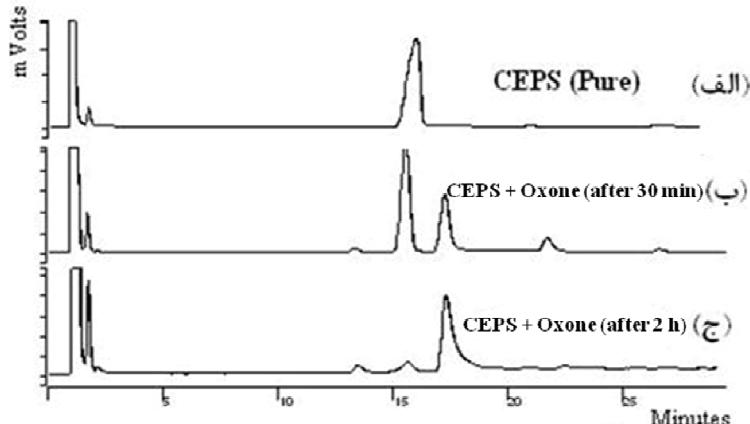
۳-۳. رفع آلودگی کلرواتیل فنیل سولفید (CEPS)
کروماتوگرام GC کلرواتیل فنیل سولفید خالص و مخلوط آن با اوکسون پس از ۳۰ دقیقه و ۲ ساعت در شکل(۷) نشان داده شده است. همان‌طور که در کروماتوگرام(الف) مشخص است، با CEPS خالص دارای زمان بازداری در حدود ۱۶ دقیقه می‌باشد. با توجه به کروماتوگرام(ب)، پس از ۳۰ دقیقه CEPS کمی تخریب و دو محصول ایجاد شده است. با توجه به کروماتوگرام(ج)، در اثر واکنش با اوکسون پس از ۲ ساعت، کاملاً تخریب و به ترکیب دیگر تبدیل شده است.

۲-۳. رفع آلودگی متیل فنیل سولفید (MPS)

کروماتوگرام GC متیل فنیل سولفید خالص و مخلوط آن با اوکسون (۵۰ مول٪) پس از ۳ دقیقه در شکل(۶) نشان داده شده است. همان‌طور که در کروماتوگرام(الف) مشخص است، MPS خالص دارای زمان بازداری در حدود ۹ دقیقه است. با توجه به کروماتوگرام(ب)، MPS در اثر واکنش با اوکسون پس از ۳ دقیقه تخریب و به دو ترکیب دیگر با زمان بازداری حدود ۱۴ و ۱۶ دقیقه تبدیل شده است. اکسیداسیون MPS با هیدروژن پراکسید فعال شده نیز منجر به همین دو ترکیب با زمان‌های بازداری مشابه شده بود که بر اساس آنالیز GC-MS و الگوهای شکست، متیل فنیل سولفوکسید و متیل فنیل سولفون تشخیص داده شده بودند[۱۸]. با توجه به شرایط مشابه می‌توان همین



شکل ۶. کروماتوگرام GC متیل فنیل سولفید (الف) خالص و (ب) مخلوط آن با اوکسون (۵۰ مول٪) پس از ۳ دقیقه



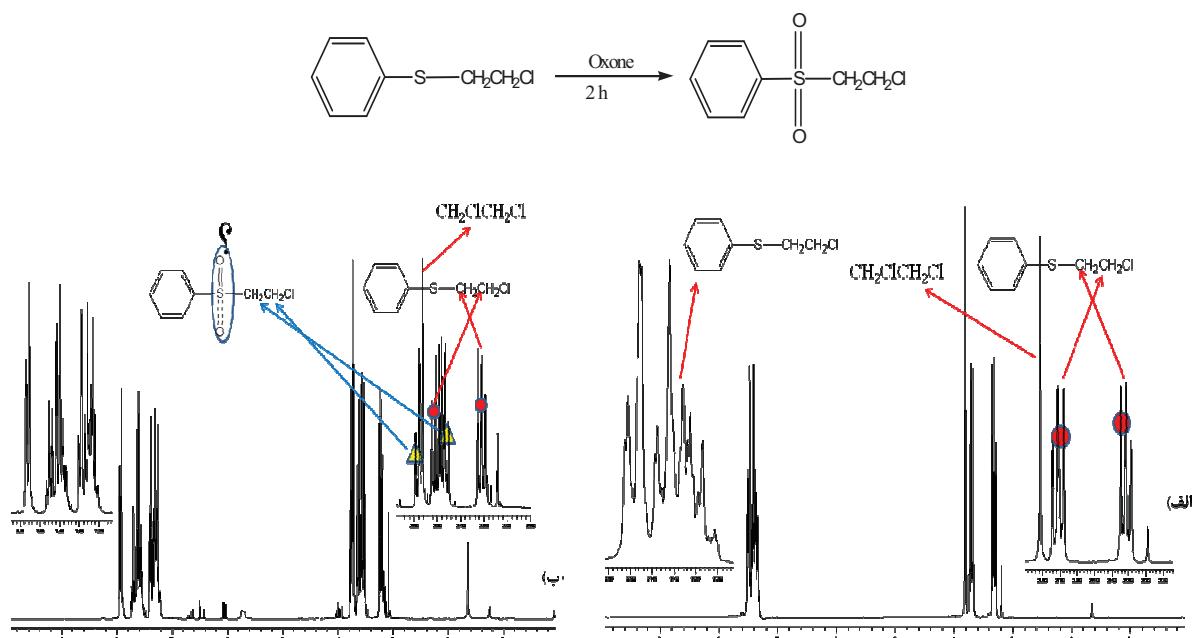
شکل ۷. کروماتوگرام GC کلرواتیل فنیل سولفید (الف) خالص، (ب) واکنش با اوکسون پس از ۳۰ دقیقه، (ج) واکنش با اوکسون پس از ۲ ساعت

همان‌طور که مشاهده می‌شود، اختلاف جایه‌جایی پروتون‌های گروه CH_2 در کلرواتیل‌فنیل‌سولفونکسید حدود ۰/۷ ppm است، در حالی که در کلرواتیل‌فنیل‌سولفون منطبق بر آن‌چه در مورد محصول رفع‌الودگی CEPS با اوکسون مشاهده می‌شود، حدود ۰/۳ ppm می‌باشد.

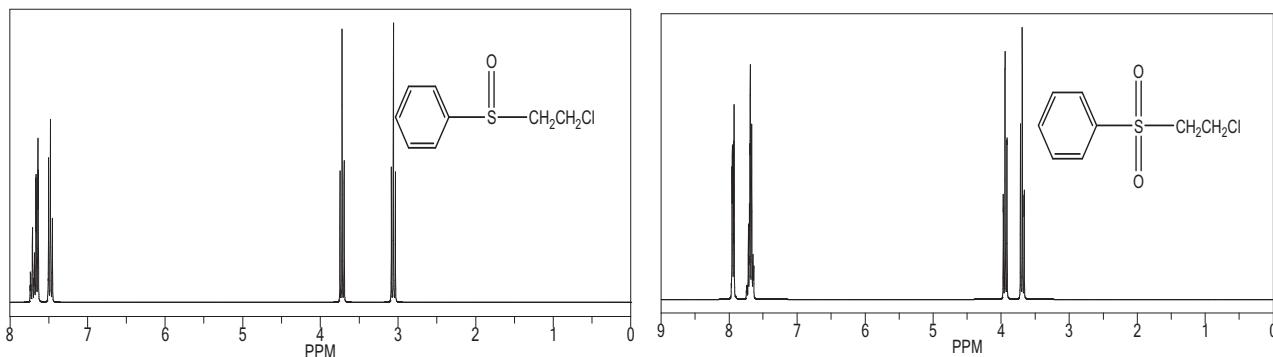
آنالیز GC-MS همین نمونه منجر به ترکیبی با زمان بازداری ۹/۲۵ دقیقه و اجزاء شکست با نسبت‌های جرمی و درصد حضور (($\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$) ۲۰۵ (۲۸)، ($\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{CH}_2$) ۱۵۶ (۱۴)، ($\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{CH}_2\text{Cl}_2$) ۱۲۵ (۲۷) و ($\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2$) ۱۴۱ (۱۰۰)، ($\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{CH}_2\text{Cl}_2$) ۱۴۱ (۱۰۰) می‌باشد. بنابراین، کلرواتیل‌فنیل‌سولفید در اثر واکنش با ۱۵ اوکسون بعد از ۱۵ دقیقه به میزان ۴۵ درصد و بعد از ۲ ساعت تقریباً به‌طور کامل تخریب و به کلرواتیل‌فنیل‌سولفون تبدیل شده است.

طیف‌های ^1H NMR ^1H NMR کلرواتیل‌فنیل‌سولفید در کلروفرم و سپس محلول ۰/۱۳ میلی‌مول آن (۰/۰۲۳ گرم) در حضور محلول ۲ میلی‌مول اوکسون در یک میلی‌لیتر آب بعد از ۱۵ دقیقه واکنش و استخراج شده با CDCl_3 در شکل (۸) نشان داده شده‌اند. طیف ^1H NMR کلرواتیل‌سولفید دو نوع گروه CH_2 با چندگانگی سه‌تایی و جایه‌جایی‌های شیمیابی متفاوت و گروه فنیل و همچنین پیک دی‌کلرواتان همراه با ترکیب اصلی (که به عنوان حلal در سنتز ترکیب مورد استفاده قرار گرفته است) را نشان می‌دهد (شکل (۸)-الف)).

با مقایسه طیف‌ها در شکل (۸)-الف و ب، وجود دو پیک جدید با چندگانگی سه‌تایی مربوط به دو نوع گروه CH_2 و یک پیک جدید مربوط به حلقه فنیل کاملاً مشخص است. احتمال وجود محصول سولفوکسید یا سولفون بیشتر از سایر ترکیبات است. برای تعیین محصول حاصل از رفع‌الودگی، طیف در شکل (۱۰-ب) با طیف‌های محصولات احتمالی حاصل از واکنش که با استفاده از نرم‌افزار ChemOffice تهیه شدند (شکل (۹))، مقایسه شد.



شکل ۸. طیف ^1H NMR (الف) کلرواتیل‌فنیل‌سولفید در کلروفرم (ب) محلول ۰/۱۳ مولار کلرواتیل‌فنیل‌سولفید در حضور محلول ۲ مولار اوکسون بعد از ۱۵ دقیقه در حلal CDCl_3 (شکل (۹))



شکل ۹. طیف‌های محصولات احتمالی حاصل از واکنش اکسیداسیون کلرواتیل‌فنیل‌سولفید با استفاده از نرم‌افزار ChemOffice

۵. مراجع

- [1] Terrorism Handbook for Operational Responders (app. B).
- [2] EPA, 2005. U.S. Environmental Protection Agency."Compilation of Available Data on Building Decontamination Alternatives."; <http://EPA.gov/nhsr>.
- [3] Yang, Y. C.; Baker, J. A.; Ward, J. R. "Decontamination of Chemical Warfare Agents.;" Chem. Rev. 1992, 92, 1729-1743.
- [4] Wagner, G. W.; Yang, Y. C. "Rapid Nucleophilic/Oxidative Decontamination of Chemical Warfare Agents.;" Ind. Eng. Chem. Res. 2002, 41(8), 1925-1928.
- [5] Krauter, P.; Garcia, E. "CBW Decontamination Agent Development.;" in: Proceedings of the Decontamination Conference 2000 Symposium, Salt Lake City, 2000.
- [6] McGuire, R.; Alcaraz, A.; Shepley, D. "The Results of Agent Testing of A Decontaminating Gel.;" in: Proceedings of 1999 Joint Service Chemical and Biological Decontamination Conference, Nashville, 1999.
- [7] Yang, Y. C.; Szfraniec, L. L.; Beaudry, W. T.; Rohrbaugh, D. K. "Oxidative Detoxification of Phosphonothiolates.;" J. Am. Chem. Soc. 1990, 112(18), 6621-6627.
- [8] Yang, Y. C. "Chemical Detoxification of Nerve Agent VX.;" Acc. Chem. Res. 1999, 32, 109-115.
- [9] Wagner, G. W.; Sorrick, D. C.; Procell, L. R.; Brickhouse, M. D.; McVey, I. F.; Schwartz, L. I. "Decontamination of VX, GD, and HD on a Surface Using Modified Vaporized Hydrogen Peroxide.;" Langmuir 2007, 23(3), 1178-1186.
- [10] Livingstone, S. R.; Kumar, D.; Landry, C. C. "Oxidation of 2-Chloroethyl Ethyl Sulfide Using V-APMS.;" J. Mol. Catal. A-Chem. 2008, 283, 52-59.
- [11] Samuel, J. B.; Beaudry, W. T.; Rohrbaugh, D. K.; Szafraniec, L. L.; Butrow, A. B.; Procell, L. R.; Sorrick, D. C.; Yang, Y. C. "Agent Neutralization Study II: Detoxification of HD with Aqueous Bleach.;" ERDEC-TR-458, Edgewood Research Development and Engineering Center, DTIC Accession no. AD-A339448, 1998.

۴. نتیجه‌گیری

مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان داد که وقتی درصد کابوسيل کمتر از ۸٪ وزنی محلول باشد، ژل به دست آمده ناپایدار و دوفازی است و بعد از همگن کردن نمونه، مجدداً دوفازی می‌شود و وقتی درصد آن بیشتر از ۸٪ وزنی محلول باشد، ژل به دست آمده پایدار و تکفازی است؛ به طوری که حتی پس از گذشت زمان و سانتریفوژ با دور بالا نیز همچنان همگن و تکفاز باقی می‌ماند. با افزایش میزان کابوسيل، گرانروی افزایش یافته و هنگامی که میزان کابوسيل به ۱۵ درصد وزنی محلول برسد، بیشینه مقدار گرانروی مشاهده می‌شود. با ادامه یافتن افزایش میزان کابوسيل، روند تغییرات گرانروی بر عکس می‌شود و گرانروی کاهش می‌یابد. مدت زمان هم زدن لازم برای تشکیل شبکه ژل، ۳۰ دقیقه می‌باشد. بعد از این مدت، ژل در اثر سکون شروع به ویسکوز شدن می‌کند. نتایج رفع آلودگی متیل‌فنیل‌سولفید (MPS) و کلرواتیل‌فنیل‌سولفید (CEPS) به عنوان شبه عامل خردل توسط اوکسون نشان داد که MPS با ۵ برابر اوکسون بعد از ۳ دقیقه اکسید و به متیل‌فنیل‌سولفون‌کسید و متیل‌فنیل‌سولفون تبدیل می‌شود. واکنش CEPS کندر بود و با ۱۵ برابر اوکسون بعد از ۱۵ دقیقه به میزان ۴۵ درصد و بعد از ۲ ساعت تقریباً به طور کامل اکسید و به کلرواتیل‌فنیل‌سولفون تبدیل شد.

- [12] Wyant, R. E.; Slivon, L. E.; Crenshaw, M. D.; Gieseke, J. A. "Final Report on Chemical Lists for Analyte Selection."; Battelle, Contract No. 92-H363340-000, 1993.
- [13] Franke, S. "Chemistry of Chemical Warfare Agents."; Manual of Military Chemistry, 1967, 1.
- [14] Raber, E.; McGuire, R. "Oxidative Decontamination of Chemical and Biological Warfare Agent Using L-Gel."; J. Haz. Mat. 2002, B93, 339-352.
- [15] DuPont, "DuPont Oxone Monopersulfate Compound Applications."; <http://www.dupont.com>, 2004.
- [16] McGuire, R.; Alcaraz, A.; Shepley, D.; Raber, E. "Oxone Based Decontamination."; in: Proceedings of International Workshop on Decontamination in a Chemical or Biological Warfare Environment. Durham, UK, 1999.
- [17] Cabot Co. "Overview of Cab-O-Sil Untreated Fumed Silica."; <http://www.cabot-corp.com>, 2002.
- [18] Fakhraian, H.; Valizadeh, F. "Activation of Hydrogen Peroxide via Bicarbonate, Sulfate, Phosphate and Urea in the Oxidation of Methyl Phenyl Sulfide."; J. Mol. Catal. A-Chem. 2010, 333, 69-72.